放射光基礎講座(その2)

高エネルギー物理学研究所 宮原 恒昱

6. 波の位相 - 微視的な場合

前号で電磁波の時間変化は、どのような測定で は可能であり、どのような測定では不可能である かについてのべた。特に定在波については、 (10)式のように $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \ge \omega t$ が変数分離されている ので、波の時間変化は exp($-i\omega t$)となることも 述べた。しかも、このように複素数で表現された 時間変化は、量子力学的な記述に特有なものであ ることについても触れた。

ここで少し量子力学を思い起してみよう。静的 なポテンシャルに束縛された一電子の状態は、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = \left(\frac{\mathbf{P}^2}{2m} + V(\mathbf{r})\right)\psi(\mathbf{r},t)$$
 (12)

というシュレーディンガー方程式の「定常」解で あるので

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{u}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t) \tag{13}$$

というように,変数分離が行える。(12)式は虚数 iを含んでいるので(13)式を実数化することは許さ れない。それどころか(13)式には,さらに複素数 的位相ファクター

 $\exp(i\theta)$

を乗じてもやはり(12)式の解になっているのであ る。そうすると,量子力学においては,位相はど のように定まるのだろうか。結論から言えば『位 相は相対的にのみ定まる』のである。たとえば (13)式に含まれるωすら単独に定まることはな い。「それは変だ、エネルギーがなぜ測定できな いのだ」という反論があるかも知れない。もちろ ん、電子の運動量を測定できればエネルギーは定 まる。だが(12)式で扱っている状態は束縛状態で あって定在波のようなものであるから、運動量 P の期待値はゼロなのである。したがって、エネル ギーすなわちωは、ある状態から別の状態への遷 移を通じて定まるのである。基準となる状態の時 間変化を exp(-ωt)とすれば、それとの差

exp $\{-i(\omega - \omega_0)t\}$

が観測にかかる量になる。実際, ω – ω。なる量は 二つの束縛状態間の遷移を伴うような吸収または 発光スペクトルによって測定可能である。

次に非束縛状態, すなわち連続状態が関係する 場合まで考えてみよう。光電子分光実験では, 束 縛状態にある電子が光で非束縛状態に励起される ので, 運動エネルギーKを測定することによっ て, 束縛エネルギーE_Bを

$$E_{\rm B} = \hbar\omega - K \tag{14}$$

によって知ることができる。このことから、非束 縛状態にかかわる $\omega_{\kappa} = K/h$ が絶対的な意味をもつ と言えるだろうか。結論から言えば、この ω_{κ} もや はり相対的な意味しかもたない。たとえば、光電 子分光装置全体が負の 10kVに帯電していたとしよ う。そうすると、大地を標準に考えると、電子は 10keVのポテンシャル・エネルギーを余分に持つ ことになる。にもかかわらず、ωκにはこのような 全エネルギーの情報を含み得ないのである。以上 より、量子力学的に記述される電子状態について 『ωはそれ自身として絶対的に定めることができ ず他のω。との差として観測にかかる』と結論され るのである。

7. 波の位相 – 巨視的な場合

前節において, 微視的に記述された波の位相は 絶対的には定義されず, 観測量でもないことを述 べた。それでは電子に関する位相はどのような場 合でも観測できないのであろうか。実は系が巨視 的に運動する場合は, 観測し得る位相が定義でき ることがあるのである。その一つは, 超電導状態 における電子のペア (クーパー・ペア)の運動で ある。クーパー・ペアは光子と同様にボーズ粒子 であるので集団的に同じ状態をとることができ る。したがって, クーパー・ペアの数を Nc とし て, 巨視的な波動関数の位相を *φ* とすると

 \triangle N_c \triangle ϕ > 1/2

という不確定性関係が成立する。この関係は、光 子についての不確定性関係、(8)式と本質的に同等 である。すなわち、微視的には観測量ではなかっ た位相が、巨視的な運動においては、より「古典 的」になり、観測にかかる量となるのである。古 典的電磁場においては位相ωtの時間微分ωが観測 にかかるのと同様に、超伝導状態については、ジ ョセフソン効果を通じてやはり位相の時間微分φ が観測されるのである。

以上の議論で重要な点は,光子についても, クーパ・ペアについても,相互作用のないボーズ 粒子であって,巨視的に同じ状態をとることがで きる,という点であることを強調しておきたい。

8. 光子間の干渉-ありふれた場合

放射光用のリングは通常, VUVからX線領域の 光を発生する目的で建設されている。しかし, リ ング内の電子は, もっと低周波の電磁波を放出し ているのである。そのうち最低周波数のものは, 多分,電子ビームの回転周期に対応するものであ る。ただし, この場合の波長は, リングの周長に 対応するから金属で作られたドーナツのために実 際には放射はおきないであろう。ドーナツを導波 管と考えると, 当然のことながらある波長より長 い電磁波は通さないからである。

次に考えられるのは、RF周波数に対応する電磁 波である。仮にf = 500MHz とすると波長は約 60cmであるから、ドーナツ内を通過できないであ ろう。しかし、RF空胴の存在するところでは電子 ビームが、この周波数もしくはその高調波を空胴 の中に放出しているはずである。このようにし て、電子ビームによって空胴内に励起された電磁 波が逆に電子ビームに悪影響を与えることがある ことは良く知られている。

しかし、ここで問題にするのは、電子ビームが 放出する電磁波が蓄積電流の2乗に比例するとい う、RFの専門家なら誰でも知っている事実であ る。一方、放射光のユーザーは、光強度が蓄積電 流に比例することを知っている。かたや、2乗に 比例し、かたや1乗に比例するという違いはどこ から来るのであろうか。結論から言えば、問題に している波長λが電子ビームのバンチ長ℓより大 きいか小さいかが問題となるのである。特にλ»ℓ の場合は、放射される電磁波のパワーは、蓄積電 流またはバンチ内の電子の個数の2乗に比例する。

以上のことを古典的に理解するのは,そう難し いことではない。まず,バンチ内の v 番目の電子 が放出する振動数ωの電磁波の電場成分を

 $E_{\nu} = E_{\nu 0} \exp\{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R} + \mathbf{r}_{\nu})\} \exp(-i \omega t)$ (15)

と書く。ここで, r,は, バンチの重心を原点とし た電子の相対位置である。ここで, 多数の電子か

-42-

らの放射を重ね合わせて考える場合、重要なのは 相対的な位相のずれだけであるから

$$\mathbf{E}_{\nu} = \mathbf{E} \exp\left\{\mathbf{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\nu}\right\} \tag{16}$$

と単純化し、Nケの電子についての和をとると

$$E_{t} = \sum_{\nu=1}^{N} E_{\nu} = E \sum \exp \{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\nu}\}$$
(17)

となる。ここで放射されるパワーは、電場の2乗 に比例するので

$$P \propto E_{t} E_{t}^{*} = E^{2} \left(\sum_{\nu} \exp\{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\nu}\} \right) \left(\sum_{\nu} \exp\{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\nu}\} \right)$$
$$= E^{2} \left(N + \sum_{\nu \neq \mu} \exp\{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_{\nu} - \mathbf{r}_{\mu})\} \right)$$
(18)

と書ける。最後の式の第二項は N(N-1) ケの項を 含んでいる。さて, λ »ℓなる条件のもとでは,

 $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_{\nu} - \mathbf{r}_{\mu}) \ll 1 \tag{19}$

であるから, (18)式は

 $P \propto E^2 N^2$

となってしまい, N²に比例するという結果が得ら れるのである。

さて、以上の効果を量子力学的に考えてみると どうなるであろうか。波数ベクトル \mathbf{k} 、かたより α の状態の光子が放出される確率 W_P は

 $W_{\rm P} \propto (n_{\rm k\alpha} + 1) |\langle f| \sum_{i}^{\rm N} \exp\{i \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_i\} (\mathbf{e}_{\rm k}^{\alpha} \cdot \mathbf{P}_i) |g\rangle|^2 (20)$

という比例関係で表わされる。ここで $\mathbf{e}_{\mathbf{k}}^{\alpha}$ はかたよ りの方向を表す単位ベクトル、|g>及び|f>はそれ ぞれ遷移の前後の状態(N電子系の波動関数)で ある。さて、ここでは、波長がバンチ長よりもは るかに長い場合を考えているから、どの電子につ いても $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\mathbf{i}} \ll 1$ である。したがって $\mathbf{W}_{\mathbf{k}}$ は単に

$$W_{\rm P} \propto n_{\rm k}^{\alpha} + 1$$

(21)

と書くことができる。上式において,第二項の1 は自然放出に関係しており,第一項は,すでに存 在する光子数に比例した誘導放出に関係している ということは,たいていの量子力学の教科書に記 述されている。

そこでいま,Nケの電子のすべてが自然放出に より光子を1ケ放出するとしよう。このとき,あ る電子に注目すると,自分が出す1ケの光子の他 に,他のN-1ケの電子が放出した光子による誘導 放出がおき,全体としてNケの光子を放出するこ とになる。したがって,Nケの電子全体では,自 然放出のみでNケの光子を放出するとき,誘導放 出をも含めると,N²ケの光子を放出することにな るのである。

ところで(20)式にたちもどると、実は電子が波 長より小さい領域におしこめられていることは、 必ずしも必要条件でないことがわかる。重要なこ とは、すべての電子について exp{ik・r_i}がほぼ同 じ値をとるということである。したがって、電子 の位置 r_iが、kベクトルの方向に波長 λ の整数倍 だけ異っている場合も同様の寄与をする。ただ し、このように電子分布が波長 λ の周期性をもつ ようなことは偶然にはおきない。電子分布をその ようにするための特別な過程が必要なのである が、これは、自由電子レーザーの基本技術の一つ となる。

9. 放射光と誘導放出

前節では、RF周波数程度の電磁波の放出は、電 子の個数の2乗すなわちN²に比例することを説明 した。量子力学的にいえば、ほとんど誘導放出に よって電磁波が放出されていることになる。通 常、放射光が利用されるVUV、X線領域では放射 光の強度がNに比例しており、自然放出だけがお きていると考えてよい。そこで、この節では、 VUV領域において誘導放出がおきるためにはどの

-43-

ような条件が必要となるかを半定量的に考えてみ よう。

まず,電子の進行方向にそって,波長 λ の長さ の領域に,1にくらべてはるかに多数の電子が含 まれているとしよう。次に誘導放出にかかわる光 子数 n^x をどのように積算すればよいか。光子はす べて光速度 c で運動しているので,単位となる領 域を定めないと n^x を定義することはできない。し かしある時刻において,進行方向に沿って光子を ならべたときに波長 λ の長さの領域に含まれる光 子が何個あるか,これこそが n^x の定義として適当 なものである。(厳密に言えば,光子密度は波長 λ の3乗の立方体と k空間の両方を考慮した 6次元空 間の中で定義するのであるが,ここでは,空間干 渉性を暗黙に仮定しており,一次元で考えても, 物理的本質は変らない)

さて,誘導放出がおきるためには,自分以外の 電子から自然放出によって放出される光子密度 n^{*} が少くとも1程度以上でなければならない。すな わち,波長λの長さの領域内で

 $n_{k}^{a} > 1 \tag{22}$

という条件を課すことにする。そこで実際に,ア ンジュレータ放射について,この光子数を見積っ てみよう。まず1ケの電子が長さL(m)のアンジュ レータを1回通過したときに放出される放射光の エネルギーΔE(eV)は

$$\Delta E(eV) = 1.265 \times 10^{3} \times E^{2}(GeV) < B_{T}^{2} > L (m)$$
(23)

で表わされる。ここで< B² >は, テスラで表わし た磁場の強さの2乗平均であるが, 磁場がサイン 関数的に変化している場合は,

$$< B_{\rm T}^2 > = B_{\rm max}^2 / 2$$
 (24)

となる。ここでアンジュレータからの放射のすべ てが基本波に集中しているとして、その光子エネ ルギー h ωを求め、Δ Eを h ωで割り算した値が1 ケの電子が放出した光子数であると仮定する。こ の仮定は明らかに光子数を過大に(場合によって は1ケタ以上)見積ることになるが、ここでは、 ごく大ざっぱな見積りをしているので気にしない ことにする。さらにアンジュレータに関する以下 の式

$$\lambda = \frac{\lambda_{\rm u}}{2\gamma^2} (1 + \frac{K^2}{2}) \tag{25}$$

$$K = 93.4 B_{max} \lambda_u (m)$$
 (26)

$$\mathbf{L} = \lambda_{\mathrm{u}} \, \mathbf{N}_{\mathrm{u}} \tag{27}$$

を用いる。ここで λ_u は周期長(m), N_uは周期数で あり、 γ は

$$\gamma = \frac{E}{m_0 c^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$
(28)

で定義される。以上を用いると

$$n = \frac{\Delta E}{\hbar \omega} = 7.58 \times 10^{-3} \,\text{K}^2 \,(1 + \frac{\text{K}^2}{2}) \,\text{N}_{\text{u}}$$
(29)

が得られる。(29)式を見ると、多くの場合電子が 一回、アンジュレータを通過しただけでは 0.1ケの オーダーの光子しか放射されないということが理 解できるであろう。

次に、1波長あたり1ケ以上の光子がある条件 は、長さLのところにL/ λ 個以上の光子が存在す るのと同じである。電子数を N_E として、この条件 を表すと

 $N_{\rm E} n > L / \lambda \tag{30}$

また電流をIEとすると

 $I_{\rm E} = N_{\rm E} \, ce/L \tag{31}$

(29), (30), (31)より最終的に
$$I_{E}(A) > \frac{1}{\lambda(A)} \times 63.4 \times \frac{1}{K^{2}(1+K^{2}/2)}N$$
 (32)

という条件が得られる。ただし、前述したよう に、(29)式で見積られた光子数は明かに過大であ る。それ故、実際に必要な電流は、(32)式の値よ りはさらに大きくなる。また、上の議論では空間 的干渉性(横方向干渉性)の不完全さを無視して いる。つまり、2つの電子が進行方向と直角方向 に位置がずれているとき、そのずれがある値より 大きいと、一番目の電子が放出した光を2番目の 電子が受けとることはできなくなるのである。こ の値は大ざっぱに言って、考えている電磁波に対 する、電子の双極子モーメントをeで割ったもの

$$\langle \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{f} \mid \mathbf{r} \mid g \rangle \tag{33}$$

の程度である。アンジュレータ内の電子は、サイ ン的に振動しているから、<r>はその振動の振幅 の程度であって通常数μmから数10μmのオーダー である。実は、この振幅は「横方向干渉性」や 「回折限界」と密接な関係があるので、後にこれ らについて説明するときに、この問題にたちかえ ることにする。

横方向干渉性を確保するには, 蓄積された電子 ビームが「低エミッタンス」であることが必要で ある。VUV・軟X線領域で誘導放出がおきれば, 自由電子レーザーが可能となるが, この実現のた めには局所的な大電流と低エミッタンスが必要条 件となるのである。



バックナンバー紹介

日本放射光学会特別シンボジウム予稿集(1991年1月)
Part1 小型光源加速器の現状と展望-リソグラフィへの出番は?
Part2 ソ連の放射光新技術
主催 日本放射光学会 後援 電子技術総合研究所
協賛 応用物理学会
体裁 Part1 B5判, Part2 (OHP集) A 4 判(全英文、2分冊)
定価 Part 1, 2, とも各1,000円

内容

Part 1 Status and Prospects of Compact Synchrotrons

May we expect their turn for lithography?

Current Techniques of Lithography

1.	Survey of Advanced Microdevice Technology
2.	The state-of-the-Art ULSI Fabrication Technologies ······S. Asai (Hitachi)
3.	Electron - beam Patterning Techniques ····································
4.	Recent Progress in Optical Lithography